



### MDA-400LJ

MDA-400LJは経済的な価格の製品であり、光源を水銀ランプではなくUV LED(365nm)使用することによって、ランプ交換が必要ないモデルで彫刻から最大4インチ試料まで工程が可能で、装備のサイズが小さく簡単な操作が特徴で、主に学校の研究室用に適しています。

#### SPEC

Type	Fully manual	Alignment method	manual
Mask size	up to 5 inch	Alignment accuracy	1 um
Substrate size	piece to 4 inch circle	Process mode	Soft, Hard, Vacuum contact & Proximity
Uniform beam size	125 mm circle	Process resolution	1 um @ 1 um PR thickness with vacuum contact
UV light source	UV LED	Weight (kg)	
Beam wavelength	365 nm	Dimensions (mm)	800(W) * 800(D) * 800(H)
Beam uniformity	<±3 %		
365 nm intensity	~ 20 mW/cm <sup>2</sup>		



### MDA-400M

MDA-400Mは、リーズナブルな価格で高い性能を発揮するマニュアル方式のマスクアライナーで、彫刻から最大4インチ試料まで工程が可能であり、装備のサイズが小さく簡単な操作が特徴で、主に学校の研究室用に適しています。

#### SPEC

Type	Fully manual	Beam uniformity	<±3 %365 nm intensity~ 25 mW/cm <sup>2</sup>
Mask size	up to 5 inch	Alignment method	manual
Substrate size	piece to 4 inch circle	Alignment accuracy	1 um
Uniform beam size	4.25 * 4.25 inch	Process mode	Soft, Hard, Vacuum contact & Proximity
UV light source	UV Lamp, 350 W	Process resolution	1 um @ 1 um PR thickness with vacuum contact
Beam wavelength	350 ~ 450 nm	Weight (kg)	
Weight (kg)		Dimensions (mm)	1080(W) * 1060(D) * 1580(H)



### MDA-400S

MDA-400Sは、合理的な価格帯の製品群であり、PCPLC制御方式のレベリングシステムが適用されたマスクアライナーで、最大6インチ試料まで工程が可能であり、小さいサイズに防塵メカニズムが基本装備されており、主に学校、研究所用に適しています。

#### SPEC

Type	Fully manual	Alignment method	manual
Mask size	up to 7 inch	Alignment accuracy	1 um
Substrate size	piece to 6 inch circle	Process mode	Soft, Hard, Vacuum contact & Proximity
Uniform beam size	6.25 * 6.25 inch	Process resolution	1 um @ 1 um PR thickness with vacuum contact
UV light source	UV Lamp, 350 W	Weight (kg)	150
Beam wavelength	350 ~ 450 nm	Dimensions (mm)	1080(W) * 1060(D) * 1580(H)
Beam uniformity	<±3 %		
365 nm intensity	~ 25 mW/cm <sup>2</sup>		

### MDA-600LJ

MDA-600LJは経済的な価格の製品であり、光源を水銀ランプではなくUV LED(365nm)使用することによって、ランプ交換が必要ないモデルで彫刻から最大6インチ試料まで工程が可能で、装備のサイズが小さく簡単な操作が特徴で、主に学校の研究室用に適しています。

#### SPEC

Type	Fully manual	365 nm intensity	~ 20 mW/cm <sup>2</sup>
Mask size	up to 7 inch	Alignment method	manual
Substrate size	piece to 6 inch circle	Alignment accuracy	1 um
Uniform beam size	170 mm circle	Process mode	Soft, Hard, Vacuum contact & Proximity
UV light source	UV LED	Process resolution	1 um @ 1 um PR thickness with vacuum contact
Beam wavelength	365 nm	Weight (kg)	150
Beam uniformity	<±5 %	Dimensions (mm)	800(W) * 800(D) * 800(H)





### MDA-600S

MDA-600Sは、Z-axisモーションがモーターで動作する半自動装置の中で最もコンパクトで価格が経済的であり、最大6インチ試料まで工程が可能です。コンパクトな装備サイズに防塵メカニズムが基本装備されており、主に学校、研究所や企業の竣工用に適しています。

#### SPEC

Type	PC control semi auto	365 nm intensity	~ 25 mW/cm <sup>2</sup>
Mask size	up to 7 inch	Alignment method	manual
Substrate size	piece to 6 inch circle	Alignment accuracy	1 um
Uniform beam size	6.25 * 6.25 inch	Process mode	Soft, Hard, Vacuum contact & Proximity
UV light source	UV Lamp, 350 W	Process resolution	1 um @ 1 um PR thickness with vacuum contact
Beam wavelength	350 ~ 450 nm	Weight (kg)	650
Beam uniformity	<±5 %	Dimensions (mm)	1256(W) * 1151(D) * 1600(H)

### MDA-80MS

MDA-80MSはZ-axisモーションがモーターで動作する半自動装備で価格が経済的であり、最大8インチ試料まで工程が可能です。防塵メカニズムが基本装備されており、主に学校、研究所、企業の準量産用に適しています。

#### SPEC

Type	PC control semi auto	Alignment method	manual
Mask size	up to 9 inch	Alignment accuracy	1 um
Substrate size	piece to 8 inch	Process mode	Soft, Hard, Vacuum contact & Proximity
Uniform beam size	8.25 * 8.25 inch	Process resolution	1 um @ 1 um PR thickness with vacuum contact
UV light source	UV Lamp, 1 kW	Weight (kg)	
Beam wavelength	350 ~ 450 nm	Dimensions (mm)	1400(W) * 1100(D) * 1600(H)
Beam uniformity	<±5 %		
365 nm intensity	~ 25 mW/cm <sup>2</sup>		





### MDA-80SA

MDA-80SAはセミオートモデルでジョイスティックでステージを制御する方式で、最大8インチ試料の工程が可能であり、研究所や企業の準量産量産用に適しています。

#### SPEC

Type	Joystick Semi-Auto	365 nm intensity	~ 25 mW/cm <sup>2</sup>
Mask size	up to 9 inch	Alignment method	Joystick control Semi-Auto
Substrate size	6 ~ 8 inch	Alignment accuracy	1 um
Uniform beam size	10.25 * 10.25 inch	Process mode	Soft, Hard, Vacuum contact & Proximity
UV light source	UV Lamp, 2 kW	Process resolution	1 um @ 1 um PR thickness with vacuum contact
Beam wavelength	350 ~ 450 nm	Weight (kg)	
Beam uniformity	<±5 %	Dimensions (mm)	



### MDA-12SA

MDA-12SAはセミオートモデルでジョイスティックでステージを制御する方式で、最大12インチ試料の工程が可能であり、研究所や企業の準量産量産用に適しています。

#### SPEC

Type	Joystick Semi-Auto	365 nm intensity	2 kW : ~ 25 mW/cm <sup>2</sup> 5 kW : ~ 45 mW/cm <sup>2</sup>
Mask size	up to 14 inch	Alignment method	Joystick control Semi-Auto
Substrate size	8 ~ 12 inch	Alignment accuracy	1 um
Uniform beam size	13.25 * 13.25 inch	Process mode	Soft, Hard, Vacuum contact & Proximity
UV light source	UV Lamp, 2 kW ,5 kW	Process resolution	2 um @ 1 um PR thickness with vacuum contact
Beam wavelength	350 ~ 450 nm	Weight (kg)	
Beam uniformity	<±5 %	Dimensions (mm)	

## MDA-20SA

MDA-20SAは、大面積工程に特化した装置で、FilmやGlassだけでなく、多様な種類の大面積基板を使用でき、使用者のニーズに合わせてオーダーメイド製作が可能です

### SPEC

Type	Joystick Semi-Auto	365 nm intensity	5 kW : ~ 45 mW/cm <sup>2</sup>
Mask size	User spec.	Alignment method	Joystick control Semi-Auto
Substrate size	User spec. (Large area)	Alignment accuracy	1 um
Uniform beam size	User spec.	Process mode	Soft, Hard, Vacuum contact & Proximity
UV light source	UV Lamp, 5 kW	Process resolution	Lens : > 3 um, Mirror : > 9 um
Beam wavelength	350 ~ 450 nm	Weight (kg)	
Beam uniformity	<±7 %	Dimensions (mm)	

## MDA-40FA

MDA-40FAはフルオート装備であり、試料サイズ2'4"の量産専用モデルで、性能対比価格が合理的であり、主に企業の量産ライン工程に適しています。

### SPEC

Type	Full automatic	365 nm intensity	~ 25 mW/cm <sup>2</sup>
Mask size	up to 5 inch	Alignment method	Full automatic
Substrate size	2 ~ 4 inch	Alignment accuracy	1 um
Uniform beam size	6.25 * 6.25 inch	Process mode	Soft, Hard, Vacuum contact & Proximity
UV light source	UV Lamp, 350 W	Process resolution	1 um @ 1 um PR thickness with vacuum contact
Beam wavelength	350 ~ 450 nm	Weight (kg)	
Beam uniformity	<±3 %	Dimensions (mm)	





### MDA-60FA

MDA-60FAは、フルオート装備で試料サイズ6"の量産専用モデルであり、性能に対する価格が合理的で、主に企業の量産ライン工程に適しています。

#### SPEC

Type	Full automatic	365 nm intensity	~ 25 mW/cm <sup>2</sup>
Mask size	up to 7 inch	Alignment method	Full automatic
Substrate size	4 ~ 6 inch	Alignment accuracy	1 um
Uniform beam size	6.25 * 6.25 inch	Process mode	Soft, Hard, Vacuum contact & Proximity
UV light source	UV Lamp, 350 W	Process resolution	1 um @ 1 um PR thickness with vacuum contact
Beam wavelength	350 ~ 450 nm	Weight (kg)	
Beam uniformity	<±5 %	Dimensions (mm)	



### MDA-80FA

MDA-80FAはフルオート装備で試料サイズ8"の量産専用モデルで、性能比価格が合理的であり、主に企業の量産ライン工程に適しています。

#### SPEC

Type	Full automatic	365 nm intensity	~ 25 mW/cm <sup>2</sup>
Mask size	up to 9 inch	Alignment method	Full automatic
Substrate size	6 ~ 8 inch	Alignment accuracy	1 um
Uniform beam size	10.25 * 10.25 inch	Process mode	Soft, Hard, Vacuum contact & Proximity
UV light source	UV Lamp, 2 kW	Process resolution	1 um @ 1 um PR thickness with vacuum contact
Beam wavelength	350 ~ 450 nm	Weight (kg)	
Beam uniformity	<±5 %	Dimensions (mm)	



### MDA-12FA

MDA-12FAはフルオート装備で試料サイズ12"の量産専用モデルで、性能対比価格が合理的であり、主に企業の量産ライン工程に適しています。

#### SPEC

Type	Full automatic	365 nm intensity	2 kW : ~ 25 mW/cm <sup>2</sup> 5 kW : ~ 45 mW/cm <sup>2</sup>
Mask size	up to 14 inch	Alignment method	Full automatic
Substrate size	8 ~ 12 inch	Alignment accuracy	1 um
Uniform beam size	13.25 * 13.25 inch	Process mode	Soft, Hard, Vacuum contact & Proximity
UV light source	UV Lamp, 2 kW ,5 kW	Process resolution	2 um @ 1 um PR thickness with vacuum contact
Beam wavelength	350 ~ 450 nm	Weight (kg)	
Beam uniformity	<±5 %	Dimensions (mm)	



### MDA-20FA

MDA-20FAはフルオート装備で試料サイズ12"以上の量産専用モデルで、性能に対する価格が合理的であり、主に企業の量産ライン工程に適しています。

#### SPEC

Type	Full automatic	365 nm intensity	2 kW : ~ 25 mW/cm <sup>2</sup> 5 kW : ~ 45 mW/cm <sup>2</sup>
Mask size	User spec.	Alignment method	Full automatic
Substrate size	User spec.	Alignment accuracy	1 um
Uniform beam size	User spec.	Process mode	Soft, Hard, Vacuum contact & Proximity
UV light source	UV Lamp, 2 kW ,5 kW	Process resolution	Lens : > 3 um, Mirror : > 9 um
Beam wavelength	350 ~ 450 nm	Weight (kg)	1,500 kg
Beam uniformity	<±5 %	Dimensions (mm)	2600(W)* 2300(D)* 2400(H)



## MDA-200SC

MDE-200SCは、Scan & Step typeの装備で、長さの長いサンプルの露光工程に適したモデルで、多様な種類の大面積基板を使用でき、使用者の必要に応じてオーダーメイド製作が可能です。

### SPEC

Type	Scan & Step Exposure	365 nm intensity	~ 25 mW/cm <sup>2</sup>
Mask size	User spec.	Alignment method	No alignment
Substrate size	User spec.	Alignment accuracy	No alignment
Uniform beam size	User spec.	Process mode	Soft, Hard, Vacuum contact
UV light source	UV Lamp, 1 kW	Process resolution	2 um @ 1 um PR thickness with vacuum contact
Beam wavelength	350 ~ 450 nm	Weight (kg)	
Beam uniformity	<±5 %	Dimensions (mm)	